



可调速调幅的旋转磁场控制的电弧离子镀弧源

文献类型: 专利

作者 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 宫骏, 赵彦辉, 华伟刚 and 闻立时

发表日期 2008-12-10

专利国别 中国

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本实用新型涉及薄膜制备领域,具体地说是一种可调速调幅的旋转磁场控制的电弧离子镀弧源。在靶材周围空间设有旋转磁场发生装置,旋转磁场发生装置为采用相差一定均匀角度、相互连接在一起的几个磁极均匀布在同一圆周上,磁极数量为 $4n$ 或者 $3n, n \geq 1$,形成一个整体的电磁回路骨架,励磁线圈套在磁极上或者嵌在相邻磁极之间的槽隙内,采用相位差 90° 的两相或者相位差 120° 的三相励磁顺序供电,在磁极包围的空间内产生可调旋转磁场。本实用新型通过可调速调幅的旋转磁场控制弧斑的运动,可以改善弧斑的放电形式和工作稳定性,提高靶材刻蚀均匀性和靶材利用率,减少...

公开日期 2008-12-10

语种 中文

专利申请号 CN201162037

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/66133>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 宫骏, 赵彦辉, 华伟刚 and 闻立时. 可调速调幅的旋转磁场控制的电弧离子镀弧源. 2008-12-10. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

119

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。